

LIN et al ICTURE AND METHOD FOR FORMING... February 11, 2002 Alan J. Kasper 202-293-7060

中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA



茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛, 其申請資料如下 :

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 西元 2001 年 03 月 15 日

Application Date

申 090106116

Application No.

人 : 光磊科技股份有限公司

Applicant(s)

局 Director General

發文日期: 西元_2001年 5 月 8 日

Issue Date

發文字號:

Serial No.

09011006413

申請	日期	
案	號	
類	別	

A4 C4

裝

線

(以上各欄由本局填註)

(以上各個由本局填註)						
	有	後明 專 利 説 明 書 新型 專 利 説 明 書				
一、發明名稱	中文	高效率之光電元件的結構及其形成方法				
	英文	·				
二、發明人	姓 名 籍 住、居所	一、林明德 二、至長達 四、蔡榮貴 一、中華民國 一、中華民國 四、中華民國 四、中華民國 一、新竹市科學園區竹村二路 12-3 號 二、嘉義縣義竹鄉義竹村 95 號 三、嘉義縣義竹鄉北華村 1 鄰 13 號 四、台北市文山區萬利街 45 號				
	姓(國 住(事務所) 人名	光磊科技股份有限公司 中華民國 新竹科學工業園區新竹縣創新一路 8 號 倪 鳳 崗				

缐

)

四、中文發明摘要(發明之名稱:

高效率之光電元件的結構及其形成方法

一種高效率之光電元件(Electro-Optics Device)的結構及其形成方法,本發明係降低晶粒承載座(Die Carrier)與光電元件之固晶面,使得光電元件發光/受光區域增加,因此可大幅度的提高光電元件的操作效率以及靈敏度的提高光電元件的操作效率以及靈敏度的,更具有可充份發揮採用透明基板元件效能以及靈敏度的,由於光電固晶時更可利用共晶或金屬熔合制,由於光電度,降低量產時因固晶不良所造成的損失,同時亦可大幅提升固晶的精確度。因此,本技術相當適合應用於高精度要求元件的封裝。

英文發明摘要(發明之名稱:

1

五、發明說明()

發明領域:

本發明係有關於一種光電元件之結構及其形成方法,特別是有關於高擷取效率之高功率光電元件之結構與形成方法。

發明背景:

發光二極體的種類繁多,用途廣泛,根據其封裝的分類,有插件式發光二極體(Through-Hold LED)、表面黏著型發光二極體(Surface-Mounted Device LED),以及輕拍晶片型 LED (Flip-Chip LED)。

五、發明說明()

(i) 傳統封裝方式的限制,以及(ii) 透明基板上的電極仍採用傳統整面背金或整面背點金的方式來製作,使得理論上採用透明基板的發光/檢光元件,應該成為正反面皆可發光/檢光的高效率光電元件,但是由於上述兩項限制,使得目前採用透明基板的元件,其發光/檢光效率的提升,僅只於透明基板側面效率的提升,而無法完全發揮採用透明基板元件的優點。

如第 1 圖所繪示,發光二極體晶粒的晶粒承載座 30,通常以導線架 (Lead Frame)、印刷電路板 (PC Board)或金屬座 (Header)作為封裝時的晶粒載具,並且與發光二極體晶粒的基板 20 連接形成發光二極體晶粒的第一電極,而發光二極體晶粒與晶粒承載座 30 之間的固晶面 40係利用銀膠、導電膠或共晶結合之方式,固定在晶粒承载座 30 上。而發光二極體晶粒上的第二電極 50 則另外連線至導線架的另一端 35。最後,發光二極體晶粒可以將晶粒承載座 30 與導線架 35 分別連接至電源使得發光二極體晶粒的磊晶結構 10 發光。

如第2圖所繪示,當發光二極體晶粒的基板70為不導電的材料時,與上述的做法相同,發光二極體晶粒與晶粒承載座80之間的固晶面90係利用銀膠固定在晶粒承載座80上。而發光二極體晶粒上的第一電極92與第二電極94

缐

五、發明説明()

則分別連線至晶粒承載座 85 與導線架 80。最後,發光二極體晶粒可以藉由晶粒承載座 80 與導線架 85 分別連接至電源使得發光二極體晶粒的磊晶結構 60 發光。

然而由於發光二極體晶粒係直接黏接於晶粒承載座上,而且由於習知的固晶面會吸收由發光二極體晶粒所產生的光線。因此,雖然發光二極體晶粒上的基板已經由透明基板所致射出的光線大部分都會被固晶面所吸收,因此降低了發光二極體的發光如率,並且無法完全發揮出運用透明基板使得發光二極體晶粒產生正、反面發光的優點。

發明目的及概述:

整於上述之發明背景中,針對固晶面會吸收發光二極體晶粒所產生的光線,導致發光二極體晶粒與晶粒承載座固定之後會降低發光二極體的發光效率之缺點,因此本發明提出一種高效率之光電元件的結構及其形成方法。

本發明的主要目的之一為本發明提出一種高效率之光電元件的結構及其形成方法,本發明係降低晶粒承載座與光電元件之固晶面,使得光電元件的發光/受光區域增加;同時,配合該結構所設計的新背金圖形,可以再降低元件

缐

五、發明説明()

背面的遮光面積,因此可大幅度的提高光電元件的發光效率以及檢光盘敏度,使元件可以發揮最大的效能。特別是對於採用透明基板的元件,本發明提供一個可以徹底發揮元件特性的結構與配合此結構之新的背金圖形,完全解決了目前該類元件無法充分發揮效能的問題。

本發明的再一目的為本發明提出一種高效率之光電元件的結構及其形成方法,運用本發明,則光電元件在固晶時更可利用共晶或金屬熔合的方式來達成自我對準的結合,如此,可大幅提高元件封裝的精確度,降低封裝時所造成的損失。

根據以上所述之目的,本發明提出一種高效率之光電元件的結構,包括:在凸出的晶粒承載座的凸出部定義出一個固晶面,具有第一電極與第二電極的光電元件晶粒連接於固晶面,並且第一電極與第二電極個別地電性連接至凸出的晶粒承載座與另一導線架。

根據以上所述之目的,本發明提出一種高效率之光電元件的形成方法,包括下列步驟:提供凸出的晶粒承載座,並在其上定義出一個固晶面,將具有第一電極與第二電極的光電元件晶粒連接於固晶面,電性連接第一電極至凸出的晶粒承載座,以及電性連接第二電極至另一個導線架。

線

五、發明説明()

圖式簡單說明:

本發明的較佳實施例將於往後之說明文字中輔以下列 圖形做更詳細的闡述,其中:

- 第 1 圖為習知發光二極體晶粒與晶粒承載座之間的連接繪示圖;
- 第 2 圖為習知基板為不導電的材料時發光二極體晶粒 與晶粒承載座之間的連接繪示圖;
- 第 3 圖為本發明發光二極體晶粒與晶粒承載座之間的 連接繪示圖;
- 第 4A 與第 4B 圖為自我對準步驟時固晶面以及晶粒的接觸面圖樣;
- 第 6 圖為本發明發光二極體晶粒與晶粒承載座另一個實施例的連接繪示圖;以及
- 第 7 圖為本發明基板為不導電的材料時發光二極體晶 粒與晶粒承載座另一個實施例的連接繪示圖。

圖號對照說明:

線

五、發明	, 引説明()		
10	磊晶結構	20	基 板
3 0	晶粒承載座	3 5	導線 架
40	固晶面	50	第二電極
60	磊晶結構	70	基 板
80	晶粒承载座	8 5	導線 架
90	固晶面	92	第一電極
94	第二電極	110	磊晶結構
120	透明基板	130	凸出的晶粒承载座
132	方形之輪廓	134	接觸區域
135	導線 架	1 3 8	基座
140	固晶面	142	方形之輪廓
144	接觸區域	145	半導體座
150	第二電極	160	透明的固定膠
170	光反射層	175	光反射層
240	光反射層	245	光反射層
250	透明的固定膠	260	磊晶结構
270	基板	280	围 晶 面
285	· 導線架	290	凸出的晶粒承載座
292	第一電極	294	第二電極
295	半導體座	298	基 座

發明詳細說明:

線

五、發明説明(

為了要達到習知發光二極體晶粒的透明基板能夠產生 正、反面發光的優點。請參照第3圖,其所繪示為本發明 發光二極體晶粒與晶粒承載座之間的連接繪示圖。由於習 知 固 晶 面 會 吸 收 光 線 降 低 了 發 光 二 極 體 的 發 光 效 率 , 所 以 本發明利用壓模的技術,設計一個凸出的晶粒承載座 130, 其中凸出部的平坦表面即為固晶面 .140 的所在,並且在凸 出的晶粒承載座 130 凸出一方的表面镀上一層具有高反射 係數的光反射層 170,如熟悉此技術之人員所瞭解的,該 反射層可以利用半導體的標準製程,如鍍膜、濺鍍、塗佈 或 電 鍍 等 方 式 , 依 元 件 特 性 , 選 擇 適 合 的 材 料 和 製 程 來 形 成光反射層,例如:不同的材料對不同波長的反射係數不 同,假如元件為一可見光波段的發光/檢光元件,則依習知 之技術,可見光波段可以選擇以銀、鋁、鈦、白金、鈦鋁 合金、砂鋁合金等金屬薄膜;或是利用複數層不同折射率 材料,如氦化鈦、氦化硼、矽和二氧化矽等單層、雙層或 兩層以上的介電薄膜所組成的材料系統,皆可做為本發明 中所述,形成高反射層之材料。由於高反射層之形成與製 造技術,為本領域之基本知識,因此本發明在此不再特別 說 明 高 反 射 層 的 形 成 與 製 造 方 法 ; 同 時 , 也 不 予 限 定 該 層 所應使用之形成技術、製造方法與材料。

接著,發光二極體晶粒的透明基板 120 再以銀膠、金 屬熔合或共晶結合之方式固定在凸出的晶粒承戴座 130 的

五、發明説明()

固晶面 140 上,如此,即可完成發光二極體在透明基板 120 上的第一電極製作。

依照本實施例,固晶面 140 的截面積係小於發光二極體晶面 140 的截面積係小於發光二極體晶粒 120 的表面積;同時,配合本結構所設計的透明基板 120 的表面積;同時,不論在晶粒背面形(請參照第 4A 和 4B 圖),不論在晶粒背面,我們均面或是半導體座的正面的固晶結合面。而是中國的固體學 4A 圖 第 4B 圖的 個形,做為固晶時的接觸面圖形),如此為 1 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4

根據以上的結構與圖形設計,磊晶結構 110 所發出的 光即可以經由透明基板 120 上沒有與固晶面 140 接觸的部 分發射出光線。而由於習知的晶粒承載座會吸收發光二極 體晶粒所產生的光,所以在凸出的晶粒承載座 130 凸出一 方的表面鍍上之高反射係數的光反射層 170 即可以防止凸 出的晶粒承載座 130 吸收光線,並將大部分由透明基板 120

線

五、發明説明()

所發射的光發散至發光二極體晶粒以外的區域,增加此發光二極體的發光效率。

當發光二極體晶粒固定在凸出的晶粒承載座 130後, 在固晶面 140的截面積很小的情況時,在處理第二電極 150 連線至另一個導線架 135 時會導致發光二極體晶粒傾斜並 脫離固晶面 140 導致製程的失敗。因此本發明更提供透明 的固定膠 160 使得整個發光二極體晶粒可以固定在凸出的 晶粒承載座 130 上,如此,在第二電極 150 連線至另一個 導線架 135 時就不會產生製程失敗的問題。

再者,本發明更提供另一種具有自我對準連線的方法來降低發光二極體晶粒與凸出的晶粒承載座 130 之間的接觸失敗。其方法如下:

如第 4A 或 4B 所給示,其中方形之輪廓 132 與 142 為發光二極體透明基板或者晶粒承載座,而中心位置之圖樣則為接觸區域 134 與 144。首先利用錫金合金(AuSn)、鉛錫合金(PbSn)、鉛銦(PbIn)合金、鉛錫銀(PbSnAg)合金、矽金(AuSi)合金、鍺金合金(AuGe)、鈹金(AuBe)合金、銦錫(InSn)合金、鈿銀(AgIn)合金、錫銀(SnAg)合金、錫銀鉛(SnAgBi)合金、鉛銀鉛(SnAgBi)合金、錫銀鉛(SnAgBi)合金、金鳍镍(AuGeNi)合金或者銦(In)等金屬在透明透明基板 120 如第 4A 或 4B 圖中

五、發明説明()

接觸位置 134 與 144 所繪示,形成具有球狀格陣列(Ball Grid Array, BGA)結構的金屬球或電極,並利用相同的方式在凸出的晶粒承载座 130 的固晶面 140 上形成如第 4A或 4B接觸位置 134 與 144 所繪示的相同金屬材料的金屬球或電極。

接著在發光二極體晶粒與凸出的晶粒承載座 130 上的 固晶 140 即可進行固晶。而在固晶時必須加熱至重 130 料的 120 以及凸出的晶粒承载座 130 上的 120 以及凸出的晶粒承或整座 130 上的 120 以及凸出的晶粒承或整座 130 上的 120 实凸出的晶粒承或整度 130 上的 120 实凸出的晶粒承或整度 130 以及凸出的晶粒承或整度 130 以及凸出的晶粒承或整度 130 以及凸出的晶粒承或整度 130 以及凸出的晶粒承或 120 实凸出的晶粒液或 130 中,使得透明基板 120 实品 120 中, 120 中,

請參照第5圖,其所繪示為本發明基板為不導電的材

線

五、發明説明()

料時發光二極體晶粒與晶粒承載座之間的連接繪示圖。首先,本發明利用壓模的技術設計一個凸出的晶粒承載座 290 其中凸出部的平坦表面即為固晶面 280,並且在凸出的晶粒承載座 290 凸出一方的表面鍍上一層具有高反射係數的光反射層 240。

接著,發光二極體晶粒的基板 270 再以銀膠、導電膠或共晶結合的方式,固定在凸出的晶粒承載座 290 的固晶面 280 上,完成固晶的動作。

依照本實施例,固晶面 280 的截面積係小於發光二極體晶粒的基板 270 的表面積,如以上所揭示的概念,磊晶結構 260 所發出的光即可以經由基板 270 上沒有與固晶面 280 接觸的部分發射出光線。而由於習知的固晶面會吸收發光二極體晶粒所產生的光,所以在凸出的晶粒承載座 290 凸出一方的表面鍍上之高反射係數的光反射層 240 即可以防止凸出的晶粒承载座 290 吸收光線,並將大部分透過基板 270 所發射的光發散至發光二極體晶粒以外的區域,增加此發光二極體的發光效率。

當發光二極體晶粒固定在凸出的晶粒承載座 290 後, 在固晶面 280 的截面積很小的情況時,在處理第一電極 292 與第二電極 294 的連線時會導致發光二極體晶粒傾斜並脫

五、發明説明()

離固晶面 280 導致製程的失敗。因此必須提供透明的固定 膠 250 使得整個發光二極體晶粒可以固定在凸出的晶粒承載座 290,如此,在第一電極 292 與第二電極 294 連線至另一個導線架 285 與凸出的晶粒承載座 290 時即可順利完成,不會產生製程失敗的問題。

由於本發明之發光二極體晶粒係為發光元件,本發明亦適用於所有的主動發光元件,例如雷射二極體,以及被動檢光元件,例如檢光二極體。當然,上述的結構以及製作方法更可以運用到所有的光電元件,例如 P型-本質-N型光二極體 (PIN Photo Diode)、雪崩式光二極體 (Avalanche Photo Diode, APD)、金屬-半導體-金屬檢光元件(Metal-Semiconductor-Metal Photo Detector, MSM)、金屬-氧化層-半導體場效電晶體元件 (Metal-Oxide-Semiconductor FET, MOSFET)、或者金屬-半導體場效電晶體元件 (Metal-Semiconductor FET, MESFET)等。本發明並不限定於發光二極體晶粒。而運用此對裝結構,可大幅度增加檢光元件的光接收效率。所以,本發明的光電元件可適用於所有的插件式光電元件、表面黏著型光電元件,以及輕拍晶片型光電元件。

請參照第6圖與第7圖,其所繪示為為本發明晶粒承載座的另一個實施例。與上述實施例的差別在於此晶粒承

線

五、發明説明()

載座包括一個半導體座 145 與 295 位於基座 138 以及 298 上,而半導體座 145 與 295 經過蝕刻後會形成具有凸出的部分,此為固晶面 140 與 280 的所在,而在半導體座 145 與 295 凸出的部分表面再形成光反射層 175 與 245,接著,將發光二極體晶粒固定在晶粒承載座後,即完成晶粒承載座與發光二極體晶粒的連接。而後續的製程則與上述實施例相同。

上述的發光二極體晶粒中的不導電基板在實際的運用上,亦可以改變為可導電的基板,並且發光二極體晶粒上的電極位在同一正面亦可達到本發明提高操作效率的目的。

因此,本發明的主要優點之一為本發明提出一種高效率之光電元件的結構及其形成方法,本發明係降低晶粒承載座與光電元件之固晶面,使得光電元件發光/受光區域增加,因此可大幅度的提高光電元件的操作效率以及靈敏度。

本發明的再一優點為本發明提出一種高效率之光電元件的結構及其形成方法,運用本發明,光電元件在連線時更可利用金屬熔融時的內聚力來達成自我對準的連線,如此,可大幅提高元件封裝的精確度,降低封裝時所造成的

五、發明説明()

損失。

如熟悉此技術之人員所瞭解的,以上所述僅為本發明之較佳實施例而已,並非用以限定本發明之申請專利範圍;凡其它未脫離本發明所揭示之精神下所完成之等效改變或修飾,均應包含在下述之申請專利範圍內。

六、申請專利範圍

申請專利範圍:

. 1.一種高效率之光電元件的結構,至少包括:

複數個凸出的晶粒承載座,任何一該凸出的晶粒承載 座的凸出部定義有一固晶面;以及

複數個光電元件晶粒,每一該光電元件晶粒具有一第一電極與一第二電極,其中該第一電極電性連接至該凸出的晶粒承載座,而該第二電極係電性連接至一導線架。

- 2.如申請專利範圍第 1 項之高效率之光電元件的結構,其中更包括一透明的固定膠用以固定該些凸出的晶粒承載座以及該些光電元件晶粒。
- 3.如申請專利範圍第 1 項之高效率之光電元件的結構,其中包括複數個光反射層位在該些晶粒承載座之表面。
- 4.如申請專利範圍第 1 項之高效率之光電元件的結構,其中該些光電元件晶粒係選擇性的由一發光二極體晶粒、一 P型-本質-N型光二極體晶粒、一霉崩式光二極體晶粒、一金屬-半導體-金屬檢光元件晶粒、一金屬-氧化層-半導體場效電晶體元件、以及一金屬-半導體場效電晶體元件所組成的群組中擇一而成。

訂

線

六、申請專利範圍

5.如申請專利範圍第 1 項之高效率之光電元件的結構,其中係以一銀膠來作為該些第一電極與該些固晶面的連線。

6 如申請專利範圍第 1 項之高效率之光電元件的結構,其中係以一導電膠來作為該些第一電極與該些固晶面的連線。

7 如申請專利範圍第 1 項之高效率之光電元件的結構,其中係以一共晶結合之方式來作為該些第一電極與該 些固晶面的連線。

8 申請專利範圍第 1 項之高效率之光電元件的結構, 其中晶粒承載座包括:

複數個基座;

複數個半導體座,任何一該半導體座之一第一表面固定於該基座,該半導體座之一第二表面具有一凸出部,係 為該固晶面;

9.如申請專利範圍第 8 項之高效率之光電元件的結構,其中包括一反射層位在每一該半導體座之該第二表面。

缐

六、申請專利範圍

- 10.如申請專利範圍第 8 項之高效率之光電元件的結構,其中係以一金屬材料來作為該些第一電極與該些固晶面的連線。
- 11.如申請專利範圍第 10 項之高效率之光電元件的結構,其中該金屬材料係選擇性的由一錫金合金、一鉛錫合金、一鉛銀合金、一鉛銀合金、一鉛銀合金、一銀銀合金、一銀銀合金、一銀銀合金、一銀銀合金、一金鉛銀合金、一金鉛銀合金、一金鉛銀合金、一銀銀合金、一金鉛銀合金以及一銀中所組成的群組中擇一形成。
- 12.如申請專利範圍第 1 項之高效率之光電元件的結構,其中該固晶面係選自於互成映像之一第一圖案與第二圖案而成一對稱型固晶面。
- 13.如申請專利範圍第 1 項之高效率之光電元件的結構,其中該固晶面係選自於不互成映像之一第一圖案與第 二圖案而成一非對稱型固晶面。
- 14.一種高效率之光電元件的形成方法,至少包括下列步驟:

提供複數個凸出的晶粒承載座,任何一凸出的晶粒承

六、申請專利範圍

戴座的凸出部定義有一固晶面;

將一光電元件晶粒的一第一電極連接於該固晶面達成 電性連接至該凸出的晶粒承載座;以及

電性連接該光電元件晶粒的一第二電極至一電性連接裝置。

15.申請專利範圍第 14 項之高效率之光電元件的結構,其中形成該凸出的晶粒承載座包括:

提供複數個基座;

蝕刻複數個半導體座,形成任一凸出的一固晶面於一 第一表面;以及

将任何一該半導體基座之一第二表面固定於該基座。

- 16.如申請專利範圍第 15 項之高效率之光電元件的結構,其中包括一反射層位在該半導體座之該第一表面。
- 17.如申請專利範圍第 14 項之高效率之光電元件的形成方法,其中該電性連接裝置係為一導線架。
- 18.如申請專利範圍第 14 項之高效率之光電元件的形成方法,其中該電性連接裝置係為一 PC 板。
 - 19.如申請專利範圍第 14 項之高效率之光電元件的形

訂

線

六、申請專利範圍

成方法,其中該電性連接裝置係為一金屬座。

20.如申請專利範圍第 14 項之高效率之光電元件的形成方法,其中更包括提供一透明的固定膠固定該凸出的晶粒承載座以及該光電元件晶粒。

21.如申請專利範圍第 14 項之高效率之光電元件的形成方法,其中更包括鍍上一光反射層在該晶粒承載座之表面。

22.如申請專利範圍第 14 項之高效率之光電元件的形成方法,其中該光電元件晶粒係選擇性的由一發光二極體晶粒、一 P型-本質-N型光二極體晶粒、一霉崩式光二極體晶粒、以及一金屬-半導體-金屬檢光元件晶粒、一金屬-氧化層-半導體場效電晶體元件、以及一金屬-半導體場效電晶體元件所組成的群組中擇一而成。

23.如申請專利範圍第 14 之高效率之光電元件的形成方法,其中更包括提供一自我對準步驟用以固定該第一電極與該固晶面,該自我對準步驟至少包括下列步驟:

在該第一電極上形成一金屬材料;

在該固晶面上形成一金屬層;以及

在一特定溫度下使相互接觸之該金屬層與該金屬材料

装

線

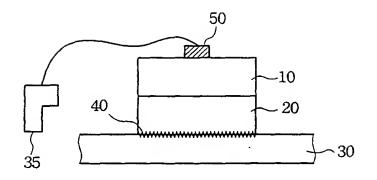
六、申請專利範圍

形成一金屬結合以完成該第一電極與晶粒承載座間的電性連接。

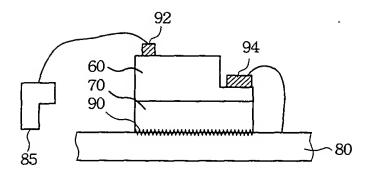
- 24.如申請專利範圍第 23 之高效率之光電元件的形成方法,其中該金屬結合係為一共晶結合。
- 25.如申請專利範圍第 23 之高效率之光電元件的形成方法,其中該金屬結合係為一金屬熔合。
- 26.如申請專利範圍第 23 項之高效率之光電元件的形成方法,其中該金屬材料係選擇性的由一錫金合金、一鉛錫合金、一鉛錫合金、一鉛銀合金、一鉛銀合金、一錫銀合金、一錫銀合金、一錫銀公合金、一錫銀公合金、一錫銀公合金、一錫銀公合金、一錫銀公合金、一銀銀公合金、一銀銀公合金、一銀銀公合金、一銀銀公合金、一銀銀公合金、一銀銀公合金、一銀銀公合金、一銀銀公合金、一銀銀公合金、一銀銀公合金、一銀銀公合金、一銀銀公司、
- 27.如申請專利範圍第 23 項之高效率之光電元件的形成方法,其中該特定溫度係為一高於該金屬材料熔點之溫度。
- 28.如申請專利範圍第 14 項之高效率之光電元件的形成方法,其中該固晶面係選自於互成映像之一第一圖案與第二圖案而成一對稱型固晶面。

六、申請專利範圍

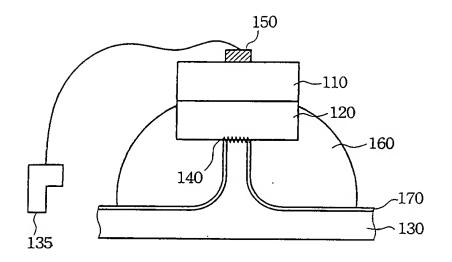
29.如申請專利範圍第 14 項之高效率之光電元件的形成方法,其中該固晶面係選自於不互成映像之一第一圖案與第二圖案而成一非對稱型固晶面。



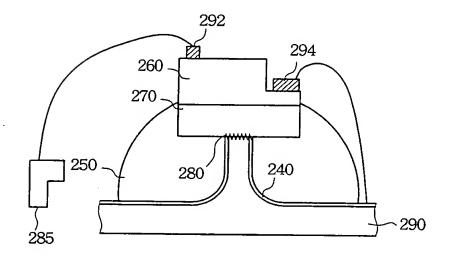
第 1 圖



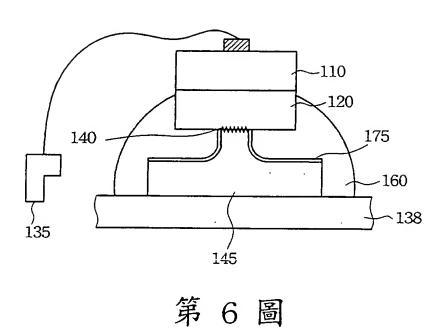
第 2 圖

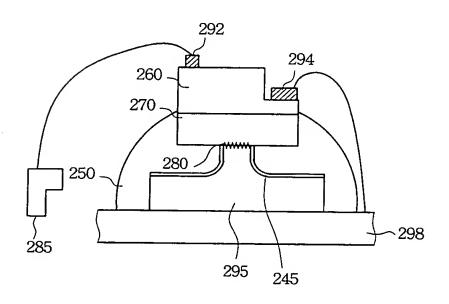


第 3 圖



第 5 圖





第7圖



Creation date: 08-14-2003

Indexing Officer: GMINIE - GELLA MINIE

Team: OIPEBackFileIndexing

Dossier: 10071204

Legal Date: 05-06-2002

Total number of pages: 6

No.	Doccode	Number of pages
1	OATH	6

Remarks:

Order of re-scan issued on